

(参考) 特許料等の減免措置一覧表(2011年4月現在)

対 象	措 置 内 容		
	出願日 ～H16. 3. 31	H16. 4. 1～H19. 3. 31	H19. 4. 1～
個人	<特 許> 審査請求料：免除、半額軽減 特許料1～3年分：免除、3年間猶予 (特許法第109条、195条の2) <実用新案> 実用新案技術評価請求料：免除、半額軽減 実用新案登録料1～3年分：免除、3年間猶予 (実用新案法第32条の2、54条)		
法人(非課税法人)	審査請求料：半額軽減 特許料1～3年分：3年間猶予 (特許法第109条、195条の2)		
研究開発型中小企業	審査請求料：半額軽減 特許料1～3年分 <sup>*</sup> ：半額軽減 (産業技術力強化法第18条、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条 <sup>*1</sup> ) ※中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく措置内容のうち、 特許料は第1～6年分が半額軽減となります。		
アカデミック・ディスカウント (大学等、大学等の研究者)	審査請求料：半額軽減 特許料1～3年分：半額軽減 (産業技術力強化法第17条)		
国立大学法人、 大学共同利用機関法人、 (独)国立高等専門学校機構		免除 (産業技術力強化法附則第3条)	※H19.4.1以降の出願は、アカデミック・ディスカウントを対象とした特許料等の減免措置が適用されます。
大学等承認TLO	審査請求料：半額軽減 特許料1～3年分：半額軽減 (産業再生法 <sup>*2</sup> 第56条、57条)		
国立大学法人承認TLO		免除 (TLO法 <sup>*3</sup> 附則第3条)	※H19.4.1以降の出願は、大学等承認TLOを対象とした特許料等の減免措置が適用されます。
独立行政法人 (H16.3.31時点で特許法施行令に指定されているもの)	免除 (改正法 <sup>*4</sup> 附則第2条4項)		
独立行政法人 (産業技術力強化法施行令に指定されているもの) <sup>*5</sup>		審査請求料：半額軽減 特許料1～3年分：半額軽減 (産業技術力強化法第17条)	
試験研究型独立行政法人 認定TLO	免除 (改正法附則第8条)	審査請求料：半額軽減 特許料1～3年分：半額軽減 (TLO法第13条)	
公設試験研究機関等 <sup>*5</sup>		審査請求料：半額軽減 特許料1～3年分：半額軽減 (産業技術力強化法第17条)	
国	免除 (特許法第107条、195条)		
国立試験研究機関 認定TLO	免除 (TLO法第13条)	免除 (TLO法第12条)	

\*1 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条に基づく「研究開発型中小企業」に対する軽減措置の適用は、平成18年6月13日以降の審査請求及び特許料納付手続から対象  
 \*2 産業再生法：産業活力再生特別措置法  
 \*3 TLO法：大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律  
 \*4 改正法：特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)  
 \*5 産業技術力強化法第17条に基づく「独立行政法人」及び「公設試験研究機関等」に対する減免措置の適用は、平成16年4月1日以降の審査請求及び特許料納付手続から対象  
 ※特許料等の減免措置の詳細は特許庁ホームページ参照  
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>